This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

PRODUCTION FOR LIQUID CRYSTAL DISPLAY ELEMENT

Patent Number:

JP10123538

Publication date:

1998-05-15

Inventor(s):

MATSUKAWA HIDEKI;; SHINSENJI SATORU;; YAMADA SATOSHI

Applicant(s):

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

Requested Patent:

☐ JP10123<u>538</u>

/ toquotion / =

Application Number: JP19960279731 19961022

Priority Number(s):

IPC Classification:

G02F1/1339

EC Classification:

Equivalents:

JP3088960B2

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide the manufacturing method of a liquid crystal display element capable of manufacturing a liquid crystal display element having excellent display quality while using ultraviolet curing resin as sealing material.

SOLUTION: Vacant cells are formed by preparing two sheets of substrates 11, 12 on whose surfaces oriented films are formed and in which rubbing processings are applied on the oriented films and by sticking them while coating a sealing material 13 made of ultraviolet curing resin on the oriented film of the substrate of one side and coating and fixing spacers on the oriented film of the substrate of other side. Next, the sealing material 13 is cured by projecting ultraviolet rays 20 condensed to be parallel rays of light only toward the sealing material 13 from the outer side of the glass substrate 12. Then, after liquid crystal material is spreaded on the whole surfaces of all vacant cells by providing a pool in which the vacant cells in which the sealing material is cured and the liquid crystal material are piled up in a vacuum bath and by sucking up the liquid crystal material into he vacant cells by a capillary action with a vacuum injection method, the cells are sealed by coating agent on injecting ports to be made a finished panel.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-123538

(43)公開日 平成10年(1998)5月15日

(51) Int.Cl.6

識別記号

G 0 2 F 1/1339

505

FΙ

G 0 2 F 1/1339

505

審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全 8 頁)

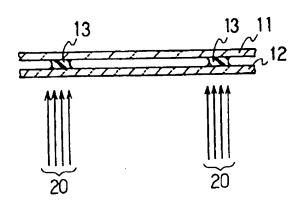
(21)出願番号	特顏平8-279731	(71) 出願人	000005821
(22)出顧日	平成8年(1996)10月22日	(72)発明者	松下電器産業株式会社 大阪府門真市大字門真1006番地 松川 秀樹
		(12/)2978	大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内
		(72)発明者	大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
		(72)発明者	産業株式会社内 山田 聡 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内
		(74)代理人	the state of the s

(54) 【発明の名称】 液晶表示素子の製造方法

(57)【要約】

【課題】 シール材として紫外線硬化型樹脂を使用しつつ、表示品位の優れた液晶表示素子を製造することができる液晶表示素子の製造方法を提供する。

【解決手段】 表面に配向膜を形成し、この配向膜にラビング処理を施した2枚のガラス基板11,12を用意し、一方の基板の配向膜上に紫外線硬化型樹脂からなるシール材13を塗布し、他方の基板の配向膜上に図示しないスペーサを散布して固着し、これらを貼り合わせて空セルを形成する。次に、平行光に集光された紫外線20をガラス基板12の外側からシール材13のみに向けて照射してシール材13を硬化させる。次にシール材13の硬化が行われた空セルと液晶材料を溜めたプールを真空槽中に設置し、真空注入法により空セル内に液晶材料を毛細管現象によって吸い上げ、空セルの全面に液晶材料が広がった後、注入口に封口剤を塗布してセルを封じ、完成パネルとする。



- 10 液晶表示素子
- 11, 12 ガラス基板
- 13 シール材
- 20 平行光に集光された紫外線

【特許請求の範囲】

【請求項1】 表面に配向膜を有する2枚の透明基板のいずれか一方の基板の配向膜上に紫外線硬化型のシール材を塗布する工程と、前記2枚の透明基板のいずれか一方の基板の配向膜上にスペーサ材を散布して固着する工程と、前記2枚の透明基板を互いの配向膜が対向するように前記シール材を介して貼り合わせる工程と、前記貼り合わされた2枚の透明基板のいずれか一方または双方の基板の外側から実質的に前記2枚の透明基板間にあるシール材のみに紫外線を照射して前記シール材を硬化させる工程とを含む液晶表示素子の製造方法。

【請求項2】 シール材の硬化工程後、貼り合わされた 2枚の透明基板のギャップ内に液晶材料を注入する工程 を含む請求項1に記載の液晶表示素子の製造方法。

【請求項3】 2枚の透明基板を貼り合わせる工程前に、前記2枚の透明基板のいずれか一方の基板の配向膜上に液晶材料を滴下する工程を含む請求項1に記載の液晶表示素子の製造方法。

【請求項4】 シール材の硬化工程が、光学手段によって集光した紫外線を2枚の透明基板のいずれか一方または双方の基板の外側から前記2枚の透明基板間にあるシール材へ向けて照射して前記シール材を硬化させる工程である請求項1~3のいずれかに記載の液晶表示素子の製造方法。

【請求項5】 シール材の硬化工程が、シール材の塗布パターンに対応した開口パターンを有する紫外線遮光部材を通過させることにより得られた紫外線のパターン光を、貼り合わされた2枚の透明基板のいずれか一方または双方の基板の外側から前記2枚の透明基板間にある前記シール材へ向けて照射して前記シール材を硬化させる工程である請求項1~3のいずれかに記載の液晶表示素子の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明はパーソナルコンピュータやワードプロセッサなどの〇A機器、ハンディ端末機器、及び携帯型情報通信機器などに使用される液晶表示素子の製造方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来の液晶表示素子の製造方法では、セル内への液晶の封入方法として真空注入法がよく使用されている。図10はこの真空注入法による液晶の注入工程を示している。これを簡単に説明すると、先ず、一主面に配向膜を形成し、この配向膜に必要に応じてラビング処理を施した2枚のガラス基板44を用意し、いずれか一方の基板の配向膜上にスペーサを散布して固着させ、更にいずれか一方の基板の配向膜上に接着剤(シール材)を印刷した後、2枚のガラス基板44を貼り合わせて空セル40を形成する。次に、この空セル40と液晶42を溜めたプール45を真空槽41中に設置し、真

空槽41中をある一定の真空度にする。次に、空セル4 0の一方の注入口43をプール45に浸した後、真空槽 41内の圧力を大気圧に戻すことによって空セル40内 に液晶42を毛細管現象によって吸い上げる。そして、 空セル40の全面に液晶が広がると注入口43に封口剤 を塗布してセルを封じる。なお、空セル40の接着剤 (シール材)としては一般的に熱硬化型樹脂または紫外 線硬化型樹脂が用いられ、塗布後に硬化処理を行ってい る。以上が真空注入法を用いた液晶表示素子の製造工程 であるが、かかる液晶表示素子の製造工程では液晶42 の注入作業に長時間を要するという欠点がある。特に、 空セル40のサイズが大きい程、真空槽41内の圧力と 空セル40内の圧力を同じにするのに時間を要する。近 年、液晶表示素子の応答速度を速めるために、セルギャ ップ(2枚のガラス基板44間のギャップ(間隔))を 従来の6~7μmから3~4μmに狭める検討が行われ ており、セルギャップを狭くすればするほど、空セル4 〇内の圧力を一定にするのに要する時間や毛細管現象に よって液晶を引き上げるのに要する時間が長くなる。こ のため、従来の数倍の作業時間が必要になっている。そ こで、このような液晶の注入作業の長時間化を解消でき る方法として図11に示す滴下工法が提案されている。 【0003】この滴下工法は以下の工程からなる。先 ず、配向膜を形成し、この配向膜に必要に応じてラビン グ処理を施した2枚のガラス基板50,51を用意し、 一方のガラス基板51に貼り合わせのためのシール材5 4をスクリーン印刷やディスペンサーなどでパターン形 成し、更に適正量の液晶52を滴下する。また、他方の 基板50にスペーサ55を散布して、固着させる。ここ で、シール材54としては硬化型樹脂が使用される。次 に、両ガラス基板50,51を真空槽53中に配置し、 槽内が最適な真空度に達したら、両ガラス基板50.5 1を貼り合わせる。そして、シール材54を硬化してセ ルギャップ(貼り合わせられたガラス基板50,51間 のギャップ)内の液晶表示素子の表示領域となる領域を 完全に封止する。そして、最後に、両ガラス基板50, 51の液晶表示素子となる部分を残して、両ガラス基板 50,51を裁断する。図11では、一個の素子領域 (液晶表示素子となる部分) しか示していないが、大面 積の基板に複数の素子領域(液晶表示素子となる部分) を形成し、ガラス基板の裁断によって個々の素子領域 (液晶表示素子となる部分)を分断して、複数の素子を 一括的に得ることも可能である。このような滴下工法で は、セル内へ液晶を配置させるために長時間を要しない ので、液晶表示素子を短時間で完成させることができ る。また、製造すべき液晶表示素子のサイズが大きくて も、また、セルギャップが狭くても、液晶表示素子を完 成させるに要する時間が全く変わらないという利点があ る。また、真空注入法のようなバッチ処理ではなく、イ ンラインで連続的に処理でき、しかも、複数の素子を一

括的に製造することができ、製造コストを削減できるというメリットもある。なお、前記シール材54としては熱硬化型樹脂よりも紫外線硬化型樹脂を使用するのが好適である。これは、熱硬化型樹脂の場合、その硬化処理時に一旦樹脂が軟化(溶融)し、この軟化(溶融)状態の樹脂が液晶に混入して液晶の特性を劣化させるためである。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】ところで、前記いずれ の製法 (真空注入法、滴下工法) においても、シール材 として紫外線硬化型樹脂が使用されている(特に、滴下 工法においては紫外線硬化型樹脂が好適に使用されてい る)。ところが、かかる紫外線硬化型樹脂を硬化するた めのセルへの紫外線の照射工程において、この紫外線が 少なからずセル内に悪影響を与えてしまう。一般的にセ ル内の配向膜に強い紫外線が照射されると、照射された 部分の特性が変化して、セル内の液晶材料(液晶分子) とのプレチルト角が変化することとなり、液晶材料(液 晶分子) 配向状態が不安定になる。また、滴下工法の場 合は、紫外線の照射時にセル内に液晶材料が存在してい るので液晶材料にも紫外線が照射され、液晶材料の抵抗 値変化や成分の分解が起こって正常な表示特性が得られ なくなる。このような紫外線の照射を受けた液晶表示素 子を信頼性試験にかけると、その多くは電流値や光学特 性が著しく劣化したものになる。また、最近の配向膜に は機械的なラビング処理ではなく、方向性を持った紫外 線を照射することによって配向がなされる光配向膜があ り、この光配向膜に紫外線が照射されると、光配向膜が 再配向して異常配向を起こすことがある。近年、液晶材 料には紫外線に対して耐性の強いもの(特性変化しにく もの) も多くなっってきているが十分ではなく、また、 エンドユーザーからの表示品位の向上に対する要求は益 々強くなってきており、シール材(紫外線硬化型樹脂) の硬化に際し、液晶材料や配向膜への紫外線の照射によ る悪影響を抑制する方法が求められている。

【0005】この発明は前記のような課題に鑑みてなされたものであり、シール材として紫外線硬化型樹脂を使用しつつ、表示品位の優れた液晶表示素子を製造することができる液晶表示素子の製造方法を提供することを目的とする。

[0006]

【課題を解決するための手段】前記目的を達成するために、本発明の液晶表示素子の製造方法は、表面に配向膜を有する2枚の透明基板のいずれか一方の基板の配向膜上に紫外線硬化型のシール材を塗布する工程と、前記2枚の透明基板のいずれか一方の基板の配向膜上にスペーサ材を散布して固着する工程と、前記2枚の透明基板を互いの配向膜が対向するように前記シール材を介して貼り合わせる工程と、前記貼り合わされた2枚の透明基板のいずれか一方または双方の基板の外側から実質的に前

記2枚の透明基板間にあるシール材のみに紫外線を照射 して前記シール材を硬化させる工程とを含む。このよう な本発明の液晶表示素子の製造方法では、シール材の硬 化工程において、セル内(貼り合わされた2枚の透明基 板内)の液晶表示素子の表示領域になるべき領域にある 配向膜には実質的に紫外線が照射されないため、配向膜 の配向性が所定の配向性に維持される。また、光配向膜 を用いた場合には、光配向膜の再配向による異常配向が 防止される。従って、前記シール材の硬化工程後に前記 貼り合わされた2枚の透明基板のギャップ内に液晶材料 を注入する態様にて液晶表示素子を完成させると、注入 後の液晶材料の配向状態は所望の好ましい配向状態とな り、表示品位の優れた液晶表示素子を製造することがで きる。また、前記2枚の透明基板を貼り合わせる工程前 に予め2枚の透明基板のいずれか一方の基板の配向膜上 に液晶材料を滴下することにより2枚の透明基板のギャ ップ内に液晶材料を配置させる態様にて液晶表示素子を 完成させると、配向膜の配向性が所定の配向性に維持さ れるとともに、シール材の硬化工程において 2枚の透明 基板のギャップ内にある液晶材料のには紫外線が照射さ れず、液晶材料の抵抗値が変化したり、成分が分解した りすることがないので、表示品位の優れた液晶表示素子 を製造することができる。

【0007】前記本発明の液晶表示素子の製造方法においては、シール材の硬化工程が、光学手段によって集光した紫外線を2枚の透明基板のいずれか一方または双方の基板の外側から前記2枚の透明基板間にあるシール材へ向けて照射して前記シール材を硬化させる工程であるのが好ましく、このような好ましい構成により、前記紫外線の選択的な照射を簡単に行うことができ、製造時間を短時間化できる。

【0008】また前記本発明の液晶表示素子の製造方法においては、シール材の硬化工程が、シール材の塗布パターンに対応した開口パターンを有する紫外線遮光部材を通過させて得られた紫外線のパターン光を、貼り合わされた2枚の透明基板のいずれか一方または双方の基板の外側から前記2枚の透明基板間にある前記シール材へ向けて照射して前記シール材を硬化させる工程であるのが好ましく、このような好ましい構成により、紫外線のシール材への選択的な照射を高精度に行うことができ、液晶材料及び配向膜への紫外線の照射がより高いレベルで抑制されることとなり、その結果、表示品位の優れた液晶表示素子を高い歩留まりで製造することができる。【0009】

【発明の実施の形態】以下、本発明の代表的な実施形態 について説明する。

(第1の実施形態)図1は本発明の第1の実施形態による液晶表示素子の製造工程におけるシール材の硬化工程を示した断面図であり、図において、11,12は各々の内側面に配向膜が形成され、この配向膜にラビング処

理が施されている一対のガラス基板、13は例えばアクリル系の紫外線硬化型樹脂からなるシール材、20は平行光に集光された紫外線である。なお、ここでは、スペーサを図示していないが、通常、2枚のガラス基板11,12間には所定の間隔(ギャップ)を保持するためにスペーサが配設されている。

【0010】以下、製造工程を説明する。先ず、表面に 配向膜を形成し、この配向膜にラビング処理を施した2 枚のガラス基板11,12を用意し、一方の基板(ガラ ス基板12)の配向膜上に紫外線硬化型樹脂からなるシ ール材13を塗布し、他方の基板(ガラス基板11)の 配向膜上に図示しないスペーサを散布して固着し、これ らを貼り合わせて空セルを形成する。ここでは、2枚の ガラス基板の一方の基板(ガラス基板12)にシール材 13を塗布し、他方の基板(ガラス基板11)にスペー サを散布して固着させたが、いずれか一方の基板にシー ル材13を塗布し、かつ、スペーサを散布して固着させ てもよい。図3はシール材13が表面に形成されたガラ ス基板12をその上方から見た平面図であり、図1では 素子領域 (実際に液晶表示素子となる部分) のみを示し ているが、この図3に示すように、多くの場合、シール 材は素子領域を区画するための線状パターン(シール 材) 13と2枚の基板の貼り合わせ強度を高めるための 補強用の線状パターン(シール材)13aとからなる。 線状パターンの幅は特に限定されないが一般に1.0~ 2. 0 m m である。

【0011】次に、図2の紫外線出射装置を用いて平行 光に集光された紫外線20をガラス基板12の外側から シール材13へ向けて照射してシール材13を硬化させ る。ここで、平行光に集光された紫外線20はシール材 13の塗布パターンに沿って走査させる。平行光に集光 された紫外線20のスポット幅(直径または長径)は、 前記シール材13,13aの幅と同等もしくは小さいこ とが必要である。ここで、図2の紫外線出射装置の構成 を簡単に説明する。図において、14は超高圧水銀灯、 15は楕円集光鏡、16は凹レンズ、20は平行光に集 光された紫外線であり、この装置は一般的に用いられる 投影露光装置の光学系である。超高圧水銀灯14から出 射した紫外線が楕円集光鏡15で集光され、更に凹レン ズ16で平行光に集光される。この平行光に集光された 紫外線20はこれら超高圧水銀灯14、楕円集光鏡15 及び凹レンズ16からなる光学系が図示しない駆動機構 によって移動することによって走査される。なお、凹レ ンズ16を用いず楕円集光鏡15の光学設計のみでも平 行光を得ることが可能である。また、平行光に集光され た紫外線20を一旦光ファイバーで取り込んで分岐させ て出射させることにより、紫外線20を走査させるため の機構を簡略化及び小型化することができる。

【0012】次に、従来と同様にして、シール材13の 硬化が行われた前記空セルと液晶材料を溜めたプールを 真空槽中に設置し、真空槽中をある一定の真空度にした 後、空セルの一方の注入口をプールに浸し、真空槽内の 圧力を大気圧に戻すことによって空セル内に液晶材料を 毛細管現象によって吸い上げる。そして、空セルの全面 に液晶が広がると注入口に封口剤を塗布してセルを封 じ、完成パネルとする。

【0013】このような本実施形態の液晶表示素子の製 造工程では、シール材13にのみ平行光に集光された紫 外線20を照射するようにしてシール材13の硬化を行 うので、セル(貼り合わされた2枚の透明基板11,1 2) 内の素子領域 (実際に液晶表示素子となる部分) に ある配向膜には実質的に紫外線が照射されない。従っ て、素子領域における配向膜の特性変化により配向膜と 液晶材料(液晶分子)間のプレチルト角が不揃いになる ことを防止することができ、その結果、しきい値ムラの ない表示品位に優れた液晶表示素子を得ることができ る。なお、平行光に集光された紫外線20がシール材1 3から外れて素子領域の配向膜に照射されてしまうこと を確実に防止し、かつ、シール材13を未硬化領域を残 すことなく硬化させるために、平行光に集光された紫外 線20のスポット幅(直径または長径)をシール材13 のパターンの幅とほぼ同等またはそれ以下の幅にし、紫 外線20を複数回走査してシール材13の未硬化領域を 無くすようにするのが好ましい。

【0014】(第2の実施形態)図4は本発明の第2の実施形態による液晶表示素子の製造工程におけるシール材の硬化工程を示した断面図であり、図において、図1と同一符号は同一または相当する部分を示し、20aが集束光に集光された紫外線である。なお、ここでは、スペーサを図示していないが、通常、2枚のガラス基板11,12間には所定の間隔(ギャップ)を保持するためにスペーサが配設されている。

【0015】すなわち、本実施形態による液晶表示素子の製造工程は、シール材13に照射する紫外線として集束光の紫外線20aを用いる以外は前記第1の実施形態のそれと基本的に同じである。なお、図5は集束光の紫外線20aを出射する紫外線出射装置である。図において、図2と同一符号は同一または相当する部分を示し、36は凸レンズである。超高圧水銀灯14から出射した紫外線が楕円集光鏡15で集光され、更に凸レンズ36で集束光に集光される。なお、集束光に集光された紫外線20aを一旦光ファイバーで取り込んで分岐させて出射させることにより、紫外線20aを走査させるための機構を簡略化及び小型化することができる。

【0016】このような本実施形態の液晶表示素子の製造工程においても、前記第1の実施形態と同様の効果を得ることができる。また、前記第1の実施形態では、シール材13のパターン幅が変更された場合、紫外線出射装置における楕円集光鏡15を取り換えるか、楕円集光鏡15とレンズ16間の距離を調整するという繁雑な作

業により、平行光の紫外線20のスポット幅(直径または長径)を変更することが必要であるが、本実施形態では紫外線出射装置の凸レンズ36を厚みの違うものに取り換えるという簡単な作業で、集東光の紫外線20aのスポット幅(直径または長径)を容易に変更できる。従って、シール材13のパターン幅が変更された場合の作業性に優れている。なお、集東光の紫外線20aがシール材13から外れて素子領域の配向膜に照射されてしまうことを確実に防止し、かつ、シール材13を未硬化領域を残すことなく硬化させるために、前記第1の実施形態と同様に、集東光の紫外線20aのスポット幅(直径または長径)をシール材13のパターンの幅とほぼ同等または長径)をシール材13のパターンの幅とほぼ同等またはそれ以下の幅にし、集東光の紫外線20aを複数回走査してシール材13の未硬化領域を無くすようにするのが好ましい。

【0017】(第3の実施形態)図7は本発明の第3の実施形態による液晶表示素子の製造工程におけるシール材の硬化工程を示した断面図であり、図において、図1と同一符号は同一または相当する部分を示し、17が液晶材料である。

【0018】図6は本実施形態の製造工程のフローチャートであり、このフローチャートは一般的な滴下工法のフローを示している。すなわち、本実施形態は滴下工法を用いた液晶表示素子の製造工程である。

【0019】以下、これらの図に基づいて液晶表示素子の製造工程を説明する。先ず、表面に配向膜を形成し、この配向膜にラビング処理を施した2枚のガラス基板11,12を用意し、一方の基板の配向膜上に紫外線硬化型樹脂からなるシール材13を塗布し、更に液晶材料17を滴下し、他方の基板の配向膜上に図示しないスペーサを散布して固着する。そして、両ガラス基板11,12を真空槽中に配置し、槽内が最適な真空度に達したら、両ガラス基板11,12を貼り合わせて、液晶セルを形成する。ここで、2枚のガラス基板11,12の一方の基板にシール材13を塗布し、他方の基板にスペーサを散布して固着させたが、いずれか一方の基板にシール材13を塗布し、更にスペーサを散布して固着させてもよい。

【0020】次に、前記第1の実施形態で使用した紫外線出射装置を用いてガラス基板12の外側からシール材13へ向けて平行光に集光された紫外線20を照射してシール材13を硬化させる。ここで、平行光に集光された紫外線20はシール材13の塗布パターンに沿って走査させる。平行光に集光された紫外線20のスポット幅(直径または長径)は、前記シール材13,13aの幅と同等もしくは小さいことが必要である。そして、最後にガラス基板の切断を行って、液晶セルの実際に液晶表示素子となる部分を取得する。

【0021】このような本実施形態の液晶表示素子の製造工程では、シール材13にのみ平行光に集光された紫

外線20を照射するようにしてシール材13の硬化を行うので、液晶セル内の素子領域(実際に液晶表示素子となる部分)にある液晶材料17及び配向膜には実質的に紫外線が照射されない。従って、素子領域における液晶材料の抵抗値が変化したり、成分が分解したりすることがなく、しかも、配向膜の特性変化により配向膜と液晶材料(液晶分子)間のプレチルト角が不揃いになることを防止することができ、その結果、しきい値ムラのない表示品位に優れた液晶表示素子を得ることができる。

【0022】なお、本実施形態において、表示品位に優 れた液晶表示素子が再現性よく得られるようにするため には、紫外線がシール材にのみ照射されるようにする精 度を、前記第1及び第2の実施形態におけるそれよりも 一層高くし、かつ、両ガラス基板の貼り合わせ後、紫外 線を照射するまでの時間を前記第1及び第2の実施形態 の製造工程におけるそれよりも短時間化する必要があ る。これは、前述のとおり、滴下工法においては、シー ル材に紫外線を照射する際、セル内にはシール材に隣接 して液晶材料が存在しており、配向膜の特性変動だけで なく液晶材料の特性変動が液晶表示素子の表示品位に大 きく影響を与えるので、この液晶材料への紫外線の照射 をできるだけ少なくする必要があり、また、両ガラス基 板の貼り合わせ後、紫外線を照射するまでの間、シール 材は未硬化状態にあるため、紫外線を照射するまでの時 間が長くなると、未硬化状態のシール材が液晶材料中に 混入して、液晶材料の特性が変動してしまうためであ

【0023】(第4の実施形態)本発明の第4の実施形態による液晶表示素子の製造工程は紫外線出射装置として前記図5に示した紫外線出射装置を用いた以外は第3の実施形態の液晶表示素子の製造工程と同様である。

【0024】このような本実施形態の液晶表示素子の製造工程でにおいても、前記第3の実施形態と同様に、シール材の硬化工程において液晶セル内の素子領域(実際に液晶表示素子となる部分)にある液晶材料17及び配向膜には実質的に紫外線を照射したりことなくシール材を硬化することができ、しきい値ムラのない表示品位に優れた液晶表示素子を得ることができる。また、前記第2の実施形態と同様に集束光の紫外線20aのスポット幅(直径または長径)を用意に変更でき、シール材13のパターン幅が変更された場合の作業性に優れるという効果が得られる。

【0025】(第5の実施の形態)図8は本発明の第5の実施形態による液晶表示素子の製造工程におけるシール材の硬化工程を示した断面図であり、図において、図1と同一符号は同一または相当する部分を示し、30は平行光や集束光に集光していない紫外線である。61は紫外線遮光部材で、これは、ガラス基板62とガラス基板62の主面に形成された黒色に着色されたレジストパターン63とからなり、シール材13の塗布パターンに

対応した開口パターン64を有している。ここで、ガラス基板62の板厚は2.0~5.0mmの範囲にして、熱などの影響によって紫外線遮光部材61が反ったりするのを防止している。なお、図9がこの紫外線遮光部材をその上方かた見た平面図である。

【0026】すなわち、本実施形態の液晶表示素子の製 造工程は、液晶セル内のシール材13の塗布パターンに 対応する開口パターン64を有する紫外線遮光部材61 を液晶セルに隣接させて配置し、この紫外線遮光部材6 1を介して液晶セルに向けて紫外線30を照射して、シ ール材13にのみ選択的に紫外線30を照射するように したものである。従って、このような本実施形態の液晶 表示素子の製造工程においても、紫外線30の照射工程 において、液晶セル内の素子領域(実際に液晶表示素子 となる部分)には紫外線が照射されないため、前記第1 の実施形態と同様に、素子領域における配向膜の特性変 化により配向膜と液晶材料(液晶分子)間のプレチルト 角が不揃いになることを防止することができ、その結 果、しきい値ムラのない表示品位に優れた液晶表示素子 を得ることができる。また、前記第1〜第4の実施形態 では紫外線を平行光や集束光に集光するための特別な光 学部材(楕円集光鏡15、凸レンズ36、凹レンズ等) を用いる必要があり、平行光や集束光に集光した紫外線 20,20 aをシール材13に向けて走査させる必要が あるが、本実施形態では紫外線遮光部材61を液晶セル に隣接させ、液晶セルの全面に対して紫外線を一回照射 するだけでよいので、作業が簡単であり、また、設備費 も安価にできる利点がある。また、前記第1〜第4の実 施形態では平行光や集束光に集光した紫外線20,20 aの走査中に誤って液晶セル内の素子領域(実際に液晶 表示素子となる部分)にある液晶材料17及び配向膜に 紫外線20,20aが照射されてしまう可能性がある が、本実施形態では液晶セル内の素子領域は紫外線遮光 部材61によって完全に遮光されるので、液晶セル内の 素子領域への紫外線の照射をより高いレベルで防止する ことができる。

【0027】(第6の実施形態)本発明の第6の実施形態による液晶表示素子の製造工程は、前記第3の実施形態と同様の滴下工法による製造工程であって、シール材の硬化工程を前記第5の実施形態におけるそれと同じにしたものである。

【0028】このような本実施形態の液晶表示素子の製造工程でにおいても、前記第3の実施形態と同様に、シール材の硬化工程において液晶セル内の素子領域(実際に液晶表示素子となる部分)にある液晶材料17及び配向膜には実質的に紫外線を照射したりことなくシール材を硬化することができ、しきい値ムラのない表示品位に優れた液晶表示素子を得ることができる。

【0029】なお、前記第5,6の実施形態で使用した 紫外線遮光部材61は、前記第1~第4の実施形態にお いても、平行光の紫外線20または集東光の紫外線20 aが誤ってセル内のシール材13の形成領域以外の領域 に照射されてしまうのを防止するための遮光部材として 使用できることは言うまでもない。

【0030】また、前記いずれの実施形態においても、一方の基板の外側から紫外線を照射しているが、両方の基板の外側から紫外線を照射してもよいことは言うまでもない。両方の基板の外側から紫外線を照射する場合、照射作業時間を短縮できる。

[0031]

【発明の効果】以上説明したように、本発明の液晶表示 素子の製造方法によれば、表面に配向膜を有する2枚の 透明基板のいずれか一方の基板の配向膜上に紫外線硬化 型のシール材を塗布する工程と、前記2枚の透明基板の いずれか一方の基板の配向膜上にスペーサ材を散布して 固着する工程と、前記2枚の透明基板を互いの配向膜が 対向するように前記シール材を介して貼り合わせる工程 と、前記貼り合わされた2枚の透明基板のいずれか一方 または双方の基板の外側から実質的に前記2枚の透明基 板間にあるシール材のみに紫外線を照射して前記シール 材を硬化させる工程とを含むことにより、シール材の硬 化工程において、セル内(貼り合わされた2枚の透明基 板内) の液晶表示素子の表示領域になるべき領域にある 配向膜に実質的に紫外線を照射することなく、シール材 を硬化することができる。この結果、液晶表示素子の表 示領域になるべき領域にある配向膜の配向性が所定の配 向性に維持され、また、光配向膜を用いた場合には、光 配向膜の再配向による異常配向が防止されることとな る。従って、シール材の硬化工程後に貼り合わされた2 枚の透明基板のギャップ内に液晶材料を注入する、所 謂、(真空)注入法にて液晶表示素子を完成させた場 合、注入後の液晶材料の配向状態は所望の好ましい配向 状態となり、表示品位の優れた液晶表示素子を製造する ことができる。また、2枚の透明基板を貼り合わせる工 程前に予め2枚の透明基板のいずれか一方の基板の配向 膜上に液晶材料を滴下する、所謂、滴下工法にて液晶表 示素子を完成させた場合、配向膜の配向性が所定の配向 性に維持されるとともに、2枚の透明基板のギャップ内 にある液晶材料抵抗値が変化したり、成分が分解したり しすることがなく、表示品位の優れた液晶表示素子を製 造することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施形態による液晶表示素子の 製造工程におけるシール材の硬化工程を示す断面図である。

【図2】本発明の第1の実施形態による液晶表示素子の 製造工程におけるシール材の硬化工程で使用した紫外線 出射装置の側面図である。

【図3】図1に示すシール材が表面に形成されたガラス 基板をその上方かた見た平面図である。 【図4】本発明の第2の実施形態による液晶表示素子の 製造工程におけるシール材の硬化工程を示す断面図である。

【図5】本発明の第2の実施形態による液晶表示素子の 製造工程におけるシール材の硬化工程で使用した紫外線 出射装置の側面図である。

【図6】本発明の第3の実施形態による液晶表示素子の 製造工程を示すフローチャート (一般的な滴下工法のフローチャート)である。

【図7】本発明の第3の実施形態による液晶表示素子の 製造工程におけるシール材の硬化工程を示す断面図である。

【図8】本発明の第5の実施形態による液晶表示素子の 製造工程におけるシール材の硬化工程を示す断面図である。 【図9】図8に示す紫外線遮光部材をその上方から見た平面図でる。

【図10】真空注入法によるセル内への液晶材料の注入 工程を示した側面図である。

【図11】滴下工法による液晶表示素子の製造工程における液晶材料滴下後の基板の貼り合わせ工程を示した側面図である。

【符号の説明】

11,12 ガラス基板

13 シール材

14 超高圧水銀灯

15 楕円集光鏡

16 凹レンズ

20 平行光に集光された紫外線

61 紫外線遮光部材

